

Fabrication

Système de gravure ionique
(RIE) : Unaxis 790

Salle: classe 100 000

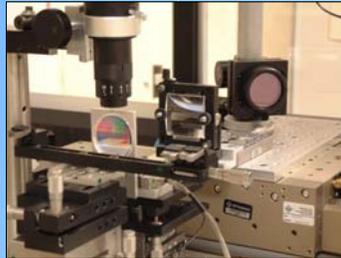
Silice fondue

Silicium

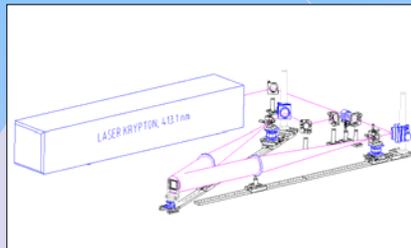
Polymères



Montage d'écriture de
réseaux de Bragg



Montage
d'enregistrement
holographique



Déposition de photorésine
par centrifugation
Karl Suss

Salle: classe 1000 à 10 000

Programmation: accélération,
vitesse et décélération



Répétiteur de masque
Karl Suss MJB3

Salle: classe 1000 à 10 000

Résolution: 0.4 μm
Lampe: 350 nm
Gaufre: 3 pouces



Déposition de couches minces

Salle: classe 1000 à 10 000

diélectriques
métalliques
chalcogénures



Caractérisation

Microscope à force atomique

Quesant

résolution X-Y: 0.5 nm

plage X-Y: 40 μm x 40 μm

résolution Z: 0.06 nm

plage Z: 4 μm



Spectromètre Cary 500

UV-VIS-NIR

bande spectrale:

175 nm à 3300 nm

résolution

UV-VIS: 0.01 nm

NIR: 0.1 nm



Profilomètre Dektak³

plage X-Y :

50 μm – 30 mm

résolution Z: 0.5 nm

plage Z: 65 μm



Système de mesure de
dispersion chromatique
Agilent

Méthode de déphasage

Spectre 1520-1620 nm

Résolution: 3 pm



Caméra UV (diagnostique de faisceau)
Coherent

Laser pulsés: excimère (248 nm,
308 nm) et vapeur de cuivre (255 nm)

Laser continu: Argon doublé (244 nm)



Ellipsomètre spectroscopique

Jobin Yvon Horiba

Spectre:300-1700nm

Précision sur l'indice de
réfraction:0.001

Épaisseur minimale: 1 Å

Algorithme de lissage:
Levenberg-Marquardt

